日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月 7日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-031189

[ST.10/C]:

[JP2001-031189]

出 願 人
Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

2002年 1月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-031189

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-36682

【提出日】 平成13年 2月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B01J 8/00

C08G 77/00

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 星 聡

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 川村 浩一

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 山崎 純明

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポリマー微粒子の製造方法および平版印刷用原板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 疎水性ポリマーを水と非混和性の溶剤に溶解した溶液を、水溶性樹脂を含んだ水相に分散させた後、該油滴から溶剤を除去し、水に分散したポリマー微粒子を生成するポリマー微粒子の製造方法であって、疎水性ポリマーが下記一般式(II)の構造単位を有し、かつ水溶性樹脂が下記一般式(II)または(III)の構造単位を有することを特徴とするポリマー微粒子の製造方法。

【化1】

(ここで、 R^1 , R^2 、 R^3 および R^4 は、それぞれ水素原子または炭素数 8 以下の炭化水素基を表し、 R^4 は炭素数 $1 \sim 4$ 0 のアルコキシ基またはアシロキシ基を表し、kは $0 \sim 2$ の整数であり、mは $0 \sim 3$ の整数であって、かつk+mは 3 以下であることを表し、Xは 1 価の金属または水素原子を表し、Zは下記から選ばれる基を表す。)

【化2】

$$\frac{-\left(CH_{2}\right)_{n}}{-CO} - \frac{\left(CH_{2}\right)_{n}}{-CO} - \frac{\left(CH_{2}\right)_{n}}{$$

(ここで、 R^5 は水素原子または炭素数 8以下の炭化水素基を表し、 R^6 は炭素数 5以下のアルキレン基または複数の連鎖炭素原子団が互いに炭素原子もしくは窒素原子で結合した 2 価の有機残基を表し、n は 0 \sim 4 の整数を表す。)

【化3】

$$\left(XO\right)_{3\cdot k\cdot m} \stackrel{\mathsf{R}^{3}_{k}}{\underset{\mathsf{R}^{4}_{m}}{\mathsf{Si}}} \left(CH_{2}\right)_{n} S \stackrel{\mathsf{R}_{1}}{\left(CH\right)} \stackrel{\mathsf{R}_{2}}{\underset{\mathsf{Y}}{\mathsf{CH}}} \left(CH_{2}\right)_{n} \left(II\right)$$

(ここで、 $R^1 \sim R^4$ 、X、kおよびmは一般式(I)と同じであり、Yは-N H $COCH_3$ 、 $-CONH_2$ 、 $-CON(CH_3)$ 2、 $-COCH_3$ 、-OH、 $-CO_2$ M、 $-OCH_3$ または下記の基を表し、Mは水素または金属イオンを表し、nは $1 \sim 8$ の整数を表す。)

【化4】

$$-N$$

【請求項2】 支持体上に、請求項1記載の製造方法で製造されたポリマー 微粒子を含有し、熱により疎水性となる親水性の画像記録層を有することを特徴 とする平版印刷用原板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、親水性マトリックス中に分散したポリマー微粒子を熱で溶融合体させる画像形成方式の平版印刷用原板に適したポリマー微粒子の製造方法、および該製造方法で製造したポリマー微粒子を含有する平版印刷用原板に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年進展が目覚ましいコンピュータ・ツウ・プレートシステム用刷版については、多数の研究がなされている。その中で、一層の工程合理化と廃液処理問題の解決を目指すものとして、露光後、現像処理することなしにそのまま印刷機に装着して印刷できる平版印刷用原板が研究され、種々の方法が提案されている。

[0003]

有望な方法の一つは、疎水性ポリマー微粒子を架橋した親水性樹脂などのマトリックス中に分散した親水層(画像記録層)を有する感熱性平版印刷用原板を用いる方法である。親水層に熱を加えると、疎水性ポリマー微粒子が溶融合体し、親水層表面が疎水性画像部に変換される。このようにして得られた疎水性画像部と親水性樹脂マトリックスの親水性非画像部で構成された表面は、液体現像などの処理を要しない完全無処理で、湿し水を用いる平版印刷の印刷版として使用できることが知られている。

[0004]

また、親水性表面を有する支持体上に、架橋していない親水性マトリックス中にポリマー微粒子を分散した画像記録層を設けた平版印刷用原板を用い、赤外線露光後の版に印刷機のシリンダーを回転しながら湿し水とインキを供給することによって、未露光部分をあたかも現像処理したように印刷機上で除去してしまう方法(機上現像法)も知られている。すなわち、印刷用原版を露光後、そのまま印刷機に装着し、通常の印刷過程の中で処理が完了する製版方式であり、印刷版の表面は熱により生成した疎水性画像部と支持体の親水性表面とからなる。

[0005]

更に、このような完全無処理もしくは機上現像に適した平版印刷用原板は、明室に置かれた印刷機にそのまま装着して印刷されるので、室内光に当たっても問題ない性質(明室取り扱い性)を有することが必要とされる。この明室取り扱い性に対しては、印刷用原板に対する露光を赤外線で行い、赤外線を吸収して発生する熱で画像を形成するヒートモード記録を利用することで達成できることが知られている。

[0006]

例えば、特開平7-1849号公報、同7-1850号公報、同10-646 8号公報および同11-70756号公報には、架橋した親水性バインダーポリマー中に親油性(疎水性)微粒子として親油性成分を内包するマイクロカプセルを分散した親水層を有する感熱性平版印刷原板が開示されており、熱の印加後、無処理で印刷できることが記載されている。

[0007]

また、例えば、日本特許2938397号公報、特開平9-127683号公報およびWO99-10186号には、親水性バインダーポリマー中に熱可塑性球水性重合体の微粒子を分散させた感光層(画像記録層)を親水性支持体上に設けた平版印刷用原板が開示されている。この公報には、該平版印刷用原板において、赤外線レーザー露光して熱可塑性球水性重合体の微粒子を熱により合体させて画像形成した後、印刷機シリンダー上に版を取付け、湿し水および/またはインキにより機上現像できることが記載されている。

[0008]

これら従来の感熱性平版印刷用原板に用いられるポリマー微粒子は、米国特許 3,476,937号に記載の方法、(1)乳化重合法、(2)疎水性ポリマーを水に非混和性の溶剤に溶かした溶液を親水性ポリマー水溶液中に界面活性剤を用いて分散する方法、もしくは(3)機械的に粉砕したポリマーを界面活性剤で分散する方法で製造されたものであった。中でも、(2)の疎水性ポリマー溶液を界面活性剤などで分散する方法が汎用性のある簡便な方法であることが知られている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

従来の疎水性ポリマー溶液を分散剤を用いて水中に分散する方法は、分散剤の 疎水性部分が疎水性ポリマー側に配向し、親水性部分が水媒体中に配向すること によって分散が行なわれるが、分散剤の疎水性部分を全て疎水性ポリマー側に配 向させることは不可能であり、一部は水媒体中に配向してしまう。そのため、ポ リマー微粒子表面を高親水性にすることができず、このようなポリマー微粒子を 用いた平版印刷用原板は、印刷において親水性が不足し、汚れやすい問題があっ た。

[0010]

本発明の目的は、この問題を解決することである。すなわち、高親水性表面をもつ疎水性ポリマー微粒子を製造する方法を提供することである。

さらに、この方法で製造したポリマー微粒子を用いて、露光後、処理を行うことなく直接印刷機に装着して印刷することが可能で、しかも汚れ難さの改良された平版印刷用原板を提供することである。

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、ポリマー微粒子のコア部分を形成する疎水性ポリマーと、分散能を有する親水性樹脂の双方に、有機珪素基を含有させることによって、親水性の高い水溶性樹脂が効果的に分散剤として機能することを見出した。すなわち、双方のシラノール基由来の水素結合もしくは脱水縮合よる強固な相互作用を利用して、高親水性の表面をもつポリマー微粒子分散物を安定に製造することが可能とし、上記課題を達成することができた。

すなわち、本発明は、下記の通りである。

1. 疎水性ポリマーを水と非混和性の溶剤に溶解した溶液を、水溶性樹脂を含んだ水相に分散させた後、該油滴から溶剤を除去し、水に分散したポリマー微粒子を生成するポリマー微粒子の製造方法であって、疎水性ポリマーが下記一般式(I)の構造単位を有し、かつ水溶性樹脂が下記一般式(II)または(III)の構造単位を有することを特徴とするポリマー微粒子の製造方法。

【化5】

-CHR¹ -CR² -
$$\frac{7}{1}$$
 (I)
$$R^{3}_{k} - Si - R^{4}_{m}$$

$$(OX)_{3-k-m}$$

[0014]

(ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、それぞれ水素原子または炭素数 8 以下の炭化水素基を表し、 R^4 は炭素数 $1\sim 4$ 0のアルコキシ基またはアシロキシ基を表し、kは $0\sim 2$ の整数であり、mは $0\sim 3$ の整数であって、かつk+mは 3 以下であることを表し、Xは 1 価の金属または水素原子を表し、Zは下記から選ばれる基を表す。)

[0015]

【化6】

$$-\left(CH_{2}\right)_{n}$$
 $-\left(CH_{2}\right)_{n}$ $-\left(CH_{2}\right)_{n}$

[0016]

(ここで、R⁵は水素原子または炭素数8以下の炭化水素基を表し、R⁶は炭素数5以下のアルキレン基または複数の連鎖炭素原子団が互いに炭素原子もしくは窒素原子で結合した2価の有機残基を表し、nは0~4の整数を表す。)

[0017]

【化7】

$$\left(XO\right)_{3-k-m} \stackrel{\mathsf{R}^{3}_{k}}{\underset{\mathsf{R}^{4}_{m}}{\mathsf{Si}}} \left(CH_{2}\right)_{n} S \stackrel{\mathsf{R}_{1}}{\longleftarrow} \left(CH - \begin{matrix} \mathsf{R}_{2} \\ \mathsf{I} \end{matrix}\right)$$

$$(II)$$

[0018]

(ここで、 $R^1 \sim R^4$ 、X、kおよびmは一般式(I)と同じであり、Yは-N H $COCH_3$ 、 $-CONH_2$ 、 $-CON(CH_3)_2$ 、 $-COCH_3$ 、-OH、 $-CO_2$ M、 $-OCH_3$ または下記の基を表し、Mは水素または金属イオンを表し、nは $1 \sim 8$ の整数を表す。)

[0019]

【化8】



[0020]

2. 支持体上に、前記1記載の製造方法で製造されたポリマー微粒子を含有し、 熱により疎水性となる親水性の画像記録層を有することを特徴とする平版印刷用 原板。

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

[0022]

[ポリマー微粒子の製造方法]

本発明のポリマー微粒子の製造方法に用いられる疎水性ポリマーは、水と非混 和性の溶剤に溶解する疎水性ポリマーであり、一般式(I)の有機珪素基を含有 する構造単位を有するポリマーである。

[0023]

この有機珪素基を含有するポリマーは、上記一般式(I)の構造単位に変換し うる不飽和二重結合性単量体を単独で重合させることにより、または、該単量体 とスチレン、アクリル系、ビニル系、オレフィン系などの単量体とを共重合させ ることにより得られる。また、本発明の有機珪素基含有ポリマーは、有機珪素基 を含有する構造単位がポリマー分子中にランダムに導入されているもののほかに 、重合体の分子末端に導入されているものでもよい。

[0024]

前記の一般式(Ⅰ)の有機珪素基を含有する構造単位に変換しうる不飽和二重 結合性単量体の具体例としては、スチリルエチルトリメトキシシラン、4-トリ メトキシシリルスチレン、3-(N-スチリルメチル-2-アミノエチルアミノ) プロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリスー (β - λ \wedge + λ + キシシラン、アリルトリアセトキシシラン、ビニルメチルジメトキシシラン、ビ ニルジメチルメトキシシラン、ビニルメチルジエトキシシラン、ビニルジメチル エトキシシラン、ビニルメチルジアセトキシシラン、ビニルジメチルアセトキシ シラン、ビニルイソブチルジメトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン 、ビニルトリブトキシシラン、ビニルトリヘキシロキシシラン、ビニルメトキシ ジヘキシロキシシラン、ビニルジメトキシオクチロキシシラン、ビニルメトキシ ジオクチロキシシラン、ビニルトリオクチロキシシラン、ビニルメトキシジラウ リロキシシラン、ビニルジメトキシラウリロキシシラン、ビニルメトキシジオレ、 イロキシシラン、ビニルジメトキシオレイロキシシラン、3-(メタ)アクリロ イルオキシプロピルトリメトキシシラン、3-(メタ)アクリロイルオキシプロ ピルトリエトキシシラン、3-(メタ) アクリルアミドープロピルトリメトキシ シラン、3-(メタ)アクリルアミドープロピルトリエトキシシラン、3-(メ g) アクリルアミドープロピルトリ(β - x トキシエトキシ)シラン、 2 - (x)タ)アクリルアミドー2ーメチルプロピルトリメトキシシラン、2ー(メタ)ア クリルアミド-2-メチルエチルトリメトキシシラン、N-(2-(メタ)アク リルアミドーエチル) -アミノプロピルトリメトキシシラン、3-(メタ) アク リルアミドープロピルトリアセトキシシラン、2-(メタ)アクリルアミドーエ チルトリメトキシシラン、1-(メタ) アクリルアミドーメチルトリメトキシシ ラン、3-(メタ)アクリルアミドープロピルメチルジメトキシシラン、3-(メタ) アクリルアミドープロピルジメチルメトキシシラン、3 - (N-メチル-(メタ) アクリルアミド) ープロピルトリメトキシシラン、3 - ((メタ) アク リルアミドーメトキシ) -3-ハイドロキシプロピルトリメトキシシラン、3-((メタ)アクリルアミドーメトキシ)ープロピルトリメトキシシラン、ジメチ

ルー3-(メタ) アクリルアミドープロピルー3-(トリメトキシシリル) ープロピルアンモニウムクロライド、ジメチルー2-(メタ) アクリルアミドー2-メチルプロピルー3-(トリメトキシシリル) ープロピルアンモニウムクロライドなどが挙げられる。

[0025]

上記の一般式(I)の有機珪素基を含有する構造単位に変換しうる不飽和二重結合性単量体とともに有機珪素基含有ポリマーを構成する共重合成分単量体としては、以下の(A)~(K)に示すモノマーを挙げることができる。

[0026]

(A) アクリル酸エステル類。この単量体群の例には、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸フェニル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸ー2ークロロエチル、アクリル酸2ーヒドロキシブチル、グリシジルアクリレート、Nージメチルアミノエチルアクリレート、oー、mーおよびpーヒドロキシフェニルアクリレートなどの(置換)アクリル酸エステルが挙げられる。

[0027]

(B) メタクリル酸エステル類。この単量体群の例には、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸オクチル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸-4-ヒドロキシブチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチルアミノエチルメタクリレート、o-、mーおよびpーヒドロキシフェニルメタクリレートなどの(置換)メタクリル酸エステルが挙げられる。

[0028]

(C) アクリルアミド及びメタクリルアミド類。この単量体群の例には、アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-メチロール メタクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド、 N-ヘキシルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-シクロヘキシルメタクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-フェニルメタクリルアミド、N-ベンジルメタクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミドおよびN-エチル-N-フェニルメタクリルアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)アクリルアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)アクリルアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミドなどのアクリルアミドもしくはメタクリルアミドが挙げられる。

[0029]

(D) ビニルエーテル類。この単量体群の例には、エチルビニルエーテル、2 ークロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテルなどが挙げられる。

[0030]

- (E) ビニルエステル類。この単量体群の例には、ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニルなどが挙げられる。
- (F) スチレン類。この単量体群の例には、スチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン、o-、m-およびp-ヒドロキシスチレンなどが挙げられる。

[0031]

- (G)ビニルケトン類。この単量体群の例には、メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトンなどが挙げられる。
- (H) オレフィン類。この単量体群の例には、エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレンなどが挙げられる。
- (I) N-含有単量体。この単量体群の例には、N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリルなどが挙げられる。

[0032]

(J)不飽和スルホンアミド。この単量体群の例には、N-(o-アミノスルホ

ニルフェニル)アクリルアミド、N-(m-r)ミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(p-r)ミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(1-(3-r)ミノスルホニル)ナフチル〕アクリルアミド、N-(2-r)ミノスルホニルンアクリルアミドなどのアクリルアミド類、N-(o-r)ミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(m-r)ミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(p-r)ミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(2-r)ミノスルホニルエチル)ナフチル〕メタクリルアミド、N-(2-r)ミノスルホニルエチル)メタクリルアミドなどのメタクリルアミド類、また、n-rミノスルホニルフェニルアクリレート、n-rミノスルホニルフェニルアクリレート、n-rミノスルホニルフェニルアクリレート、n-rミノスルホニルフェニルアクリレート、n-rミノスルホニルフェニルアクリレート、n-rミノスルホニルフェニルナフチル)アクリレートなどのアクリル酸エステル類などの不飽和スルホンアミド、n-rミノスルホニルフェニルメタクリレート、n-rミノスルホニルフェニルメタクリレート、n-rミノスルホニルフェニルメタクリレート、n-rミノスルホニルフェニルメタクリレートなどが挙げられる。

[0033]

(K)不飽和酸無水物。この単量体群の例には、無水イタコン酸、無水マレイン酸、2,3-ジメチル無水マレイン酸、2-クロル無水マレイン酸などが挙げられる。

[0034]

これらの単量体から得られる有機高分子化合物は、重量平均子量が500~500,000、数平均分子量が200~6000であることが好ましい。

以下に有機珪素基含有ポリマーの具体例を示すが、これらに限定されない。

[0035]

【化9】

[0036]

PI-1
$$+\downarrow_{90}$$
 $+\downarrow_{10}$ $+\downarrow_{20}$ $+\downarrow_{20}$

【化10】

$$(PI-6) \longleftrightarrow_{CO_2CH_2CH_2OH} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-7) \longleftrightarrow_{60} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-8) \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-9) \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-10) \longleftrightarrow_{OCOCH_3} \longleftrightarrow_{CO_2} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-11) \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2} \longleftrightarrow_{Si(OEt)_3} (PI-11) \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-11) \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2} \longleftrightarrow_{Si(OMe)_3} (PI-11) \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} \longleftrightarrow_{CN} \longleftrightarrow_{CO_2CH_3} (OMe)_3$$

本発明において使用される疎水性ポリマー中の有機珪素基を含有する構造単位の含有量は、0.01~100モル%が好ましく、0.05から90モル%がさらに好ましく、とくに0.1から80モル%が好ましい。有機珪素基を含有する構造単位の含有量が0.01モル%より少ない場合には本発明の効果が乏しい。

[0038]

[0037].

本発明における水と非混和性溶剤の具体例としては、クロロメタン、ジクロロ

メタン、酢酸エチル、メチルエチルケトン(MEK)、トリクロロメタン、四塩 化炭素、エチレンクロライド、トリクロロエタン、トルエン、キシレン、シクロ ヘキサノン、2-ニトロプロパンなどのような疎水性ポリマーを溶解し水と不混 和性のあらゆる適当な溶剤が本発明の実施に使用できる。中でも特に有用な溶剤 としては、ジクロロメタンとMEKを挙げることができる。これらは、蒸発によ り油層粒子から溶剤を除去するのにも適している。

[0039]

本発明に用いられる水溶性樹脂は、一般式(II)または(III)の構造単位を 有することを特徴とする。以下に具体例を示すが、これに限定されない。

[0040]

【化11】

[0041]

【化12】

WIII-1	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
WIII-2	$\begin{array}{c} + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + $
WIII-3	
WIII-4	
WIII-5	
WIII-6	
WIII-7	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
WIII-8	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
WIII-9	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
WIII-10	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

[0042]

ポリマー微粒子における上記水溶性樹脂の含有量は、1~25質量%が適当であり、好ましい範囲は2~15質量%である。

[0043]

本発明のポリマー微粒子製造方法においては、一般式(I)、一般式(II)および一般式(III)で示されるポリマーの有機珪素基の加水分解および重縮合反応を促進するために、酸性触媒または塩基性触媒を用いることができる。

酸性触媒または塩基性触媒の種類は特に限定されないが、高濃度の触媒を用いる必要がある場合には、微粒子作製後にほとんど残留しないような元素から構成される触媒がよい。

[0044]

具体的には、酸性触媒としては、塩酸などのハロゲン化水素、硝酸、硫酸、亜硫酸、硫化水素、過塩素酸、過酸化水素、炭酸、蟻酸や酢酸などのカルボン酸、そのRCOOHで表される構造式のRを置換した置換カルボン酸、ベンゼンスルホン酸などのスルホン酸などが挙げられる。また、塩基触媒としては、アンモニアや、エチルアミンやアニリンなどのアミン類などが挙げられる。

触媒は、そのままか、または水もしくはアルコールなどの溶媒に溶解した状態で、水相に加えられる。

加える触媒の濃度は、特に限定しないが、濃度が高い場合は加水分解や重縮合速度が速くなる傾向がある。ただし、高濃度の塩基性触媒を用いると、分散溶液中で沈殿物が生成する場合があるので、塩基性触媒の濃度は1N以下が望ましい

[0045]

本発明のポリマー微粒子の製造方法に用いられる界面活性剤としては、ノニオン系及びアニオン系界面活性剤のほか、特開平2-195356号公報に記載されているようなカチオン界面活性剤、含フッ素界面活性剤、及び特開昭59-121044号及び特開平4-13149号公報に記載されている両性界面活性剤を挙げることができる。

[0046]

ノニオン界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレンラウリルエーテル 、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル 、ポリオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエー テル類、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどのポリオキシエチレン アルキルアリールエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロ ックコポリマー類、さらにポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロック コポリマーの端末のヒドロキシル基に炭素数5~24の脂肪族基がエーテル結合 した複合ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、同じくアルキル置換アリー ル基がエーテル結合した複合ポリオキシアルキレンアルキルアリールエーテル類 、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリス テアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノオレート、ソルビタ ントリオレートなどのソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビ タンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオ キシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリ ステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレートなどのポリオキシエ チレンソルビタン脂肪酸エステル類などが挙げられる。

[0047]

アニオン系活性剤の具体例としては、アルキルスルホン酸類、アリールスルホン酸類、脂肪族カルボン酸類、アルキルナフタレンスルホン酸類、アルキルナフタレンスルホン酸又はナフタレンスルホン酸とホルムアルデヒドの縮合型のもの、炭素数9~26の脂肪族スルホン酸類、アルキルベンゼンスルホン酸類、ラウリルポリオキシエチレン硫酸、セチルポリオキシエチレンスルホン酸、オレイルポリオキシエチレンホスホン酸などのポリオキシエチレン含有硫酸やポリオキシエチレン含有燐酸などが挙げられる。

[0048]

カチオン界面活性剤の具体例としては、ラウリルアミンアセテート、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド、ジステアリルジメチルアンモニウムクロライド、アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロライドなどが挙げられる。

フッ素系界面活性剤の具体例としては、パーフルオロアルキルカルボン酸塩、

パーフルオロアルキルリン酸エステル、パーフルオロアルキルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキルベタイン、パーフルオロアルキルアミンキシド、パーフルオロアルキルEO付加物などが挙げられる。

[0049]

両性界面活性剤の具体例としては、アルキルカルボキシベタイン類、アルキルアミノカルボン酸類、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名アモーゲンK、第一工業(株)製)等が挙げられる。

[0050]

中でも、アニオン系、ノニオン系、両性系が好ましく、具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、アルキルスルホン酸類、脂肪族カルボン酸類、アルキルベンゼンスルホン酸類、ポリオキシエチレン含有硫酸、アルキルナフタレンスルホン酸又はナフタレンスルホン酸とホルムアルデヒドの縮合型のもの、アルキルカルボキシベタイン類、アルキルアミノカルボン酸類等が挙げられる。

[0051]

上記のように、疎水性ポリマーと水溶性ポリマーに特定の有機珪素基を有するポリマーを用いることによって良好なポリマー微粒子が得られ、珪素基の熱反応性が、画像記録層を形成する樹脂、例えばゾルゲル変換系の結着樹脂との組み合わせにおいては、結着樹脂マトリックスと直接化学結合できるため、機械強度に優れた、耐摩耗性の良好な皮膜を形成できる。この感光層のレーザー光照射を受けて疎水性に変換した被照射領域においても、同様に結着樹脂と化学結合したまま均一層を形成できるので、耐摩耗性に優れた画像領域が形成される。

[0052]

本発明の疎水性ポリマー微粒子の製造には、上記成分の他に、水相に周期表 2 族~15族の元素から選ばれた少なくとも一つの元素の酸化物または水酸化物微粒子を添加することができる。好適な元素の具体例として、マグネシウム、チタ

ン、ジルコニウム、バナジウム、クロム、亜鉛、アルミニウム、珪素、錫、鉄などを挙げることができる。中でも好ましい元素として、珪素、チタン、アルミニウム、錫を挙げることができる。

上記元素の酸化物または水酸化物微粒子は、酸化物または水酸化物コロイドとして用いることができ、微粒子の粒径は、一般に約0.001~1μm、好ましくは5~40nm、最も好ましくは10~30nmである。

これらのコロイドの分散液は、日産化学工業(株)などの市販品を購入することもできる。

これらの化合物の添加により、水に対する分散安定性が一層良好なポリマー微 粒子が得られ、平版印刷用原板にしたときの汚れ難さが強化される。

[0053]

上記の原料を用いたポリマー微粒子の製造は、良く知られた操作で行うことができる。すなわち、疎水性ポリマーを水と非混和性の溶剤に溶かした油相溶液と、水溶性樹脂および界面活性剤、さらに必要に応じて周期表2族~15族の元素から選ばれた少なくとも一つの元素の酸化物または水酸化物微粒子や酸性または塩基性触媒を含んだ水相溶液を調製した後、両者を混合し、ホモジナイザーなどの乳化分散機を用いて、例えば、12,000rpmで10~15分間激しく攪拌混合して水相中に油滴を乳化分散する。次いで、得られた乳化分散物を加熱攪拌して溶剤を蒸発させることにより、目的とするポリマー微粒子の水分散物が得られる。

[0054]

[ポリマー微粒子を用いた平版印刷用原板]

以下に、上記の方法で製造されたポリマー微粒子を含有する画像記録層を支持 体上に有する平版印刷用原板について説明する。

[0055]

[画像記録層]

画像記録層中の本発明の製造方法による微粒子ポリマーの含有量は、画像記録層の固形分の10~80質量%が好ましく、20~60質量%がさらに好ましい。添加量が10質量%より少ない場合には光照射部の親油性が足らず着肉性に劣

り、80質量%を超えると親水性が不足して印刷汚れの原因となる。

[0056]

本発明のポリマー微粒子は、好ましくは画像記録層では親水性の結着樹脂中に分散されている。親水性の結着樹脂としては、親水性高分子結着樹脂又は親水性のゾルゲル変換系結着樹脂であることが好ましく、そのなかでも高い親水性及び熱反応による画像記録層の破壊に耐えうる結着樹脂としてポリシロキサンのゲル組織を形成する性質を有するゾルゲル変換系結着樹脂が好ましい。

[0057]

親水性結着樹脂の具体例としては、アラビアゴム、ポリビニルアルコール(P VA)類、澱粉及びその誘導体、カルボキシメチルセルローズ及びそのナトリウ ム塩やヒドロキシエチルセルローズあるいはセルロースアセテートのようなセル ロース誘導体、アルギン酸ナトリウム、カゼイン、ゼラチン、ポリビニルピロリ ドン、酢酸ビニルーマレイン酸共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、アル ギン酸及びそのアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩、ポリ アクリル酸及びそれらの塩、ポリメタクリル酸及びそれらの塩、ポリ(エチレン オキサイド)、水溶性ウレタン樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、ヒドロキシエチ ルアクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシエチルメタクリレー トのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシプロピルアクリレートのホモポリ マー及びコポリマー、ヒドロキシプロピルメタクリレートのホモポリマー及びコ ポリマー、ヒドロキシブチルアクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒド ロキシブチルメタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ポリエチレングリ コールジアクリレート系ポリマー、ヒドロキシプロピルメタクリレートのホモポ リマー及びコポリマー、ポリエチレングリコール類、ポリ(ヒドロキシプロピレ ン)類等の水溶性樹脂が挙げられる。

[0058]

又、好ましくは上記親水性樹脂を架橋して用いてもよく、その場合の樹脂を硬化させる耐水化剤としては、グリオキザール、メラミンホルムアルデヒド樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹脂などのアルデヒド類、N-メチロール尿素やN-メチロールメラミン、メチロール化ポリアミド樹脂などのメチロール化合物、ジビニ

ルスルホンやビス(β ーヒドロキシエチルスルホン酸)などの活性ビニル化合物、エピクロルヒドリンやポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリアミド・ポリアミン・エピクロロヒドリン付加物、ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂などのエポキシ化合物、モノクロル酢酸エステルやチオグリコール酸エステルなどのエステル化合物、ポリアクリル酸やメチルビニルエーテル/マレイン酸共重合物などのポリカルボン酸類、ほう酸、チタニルスルフェート、Cu、A1、Sn、V、Cr 塩などの無機系架橋剤、変成ポリアミドポリイミド樹脂などが挙げられる。

そのほか、塩化アンモニウム、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤などの架橋触媒を併用できる。

[0059]

本発明の画像記録層の特に好ましい結着剤は、以下に述べるゾルゲル変換系結着樹脂である。本発明に好ましく適用できるゾルゲル変換が可能な系は、多価元素から出ている結合基が酸素原子を介して網目状構造を形成し、同時に多価金属は未結合の水酸基やアルコキシ基も有していてこれらが混在した樹脂状構造となっている高分子体であって、アルコキシ基や水酸基が多い段階ではゾル状態であり、脱水縮合が進行するのに伴って網目状の樹脂構造が強固となる。

ゾルゲル変換を行う水酸基やアルコキシ基を有する化合物の多価結合元素は、 アルミニウム、珪素、チタン及びジルコニウムなどであり、これらはいずれも本 発明に用いることができるが、以下はもっとも好ましく用いることのできるシロ キサン結合によるゾルゲル変換系について説明する。アルミニウム、チタン及び ジルコニウムを用いるゾルゲル変換は、下記の説明の珪素をそれぞれの元素に置 き換えて実施することができる。

すなわち、特に好ましく用いられるのはゾルゲル変換が可能な、少なくとも1個のシラノール基を有するシラン化合物を含んだ系である。

[0060]

以下に、ゾルゲル変換を利用する系についてさらに説明する。

ゾルゲル変換によって形成される無機親水性結着樹脂は、好ましくはシロキサン結合及びシラノール基を有する樹脂であり、本発明の平版印刷版用原板の画像

記録層は、少なくとも1個のシラノール基を有するシラン化合物を含んだゾルの 系である塗布液を、塗布後の経時の間に、シラノール基の加水分解縮合が進んで シロキサン骨格の構造が形成され、ゲル化が進行することによって形成される。

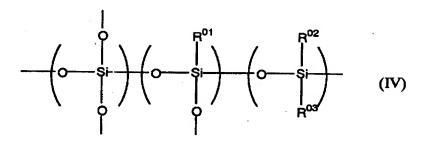
[0061]

また、このゾルゲル変換によって形成される層は、膜強度、柔軟性などの物理 的性能の向上や、塗布性の改良などを目的として、後述する有機親水性ポリマー や架橋剤などを添加することも可能である。

ゲル構造を形成するシロキサン樹脂は下記一般式(IV)で、少なくとも1個のシラノール基を有するシラン化合物は下記一般式(V)で示される。また、画像記録層に含まれる物質は、必ずしも一般式(V)のシラン化合物単独である必要はなく、一般にはシラン化合物が部分加水重合したオリゴマーからなっていてもよく、あるいは、シラン化合物とそのオリゴマーの混合組成であってもよい。

[0062]

【化13】



[0063]

上記一般式(IV)のシロキサン系樹脂は、下記一般式(V)で示されるシラン化合物の少なくとも 1 種を含有する分散液からゾルーゲル変換によって形成され、一般式(IV)中の $R^{01}\sim R^{03}$ の少なくとも一つは水酸基を表し、他は下記一般式(V)中の記号の R^0 及びYから選ばれる有機残基を表わす。

[0064]

$$(R^0)_{n} Si(Y)_{4-n} \qquad (V)$$

[0065]

一般式 (V) 中、 R^0 は水酸基、炭化水素基又はヘテロ環基を表わす。Yは水素原子、ハロゲン原子、 $-OR^1$ 、 $-OCOR^2$ 、又は、 $-N(R^3)(R^4)$ を表

す(R^1 、 R^2 は、各々炭化水素基を表し、 R^3 、 R^4 は同じでも異なってもよく、水素原子又は炭化水素基を表す)。 n は 0 、 1 、 2 又は 3 を表わす。

[0066]

一般式(V)中のR⁰の炭化水素基又はヘテロ環基とは、例えば炭素数1~12の置換されてもよい直鎖状もしくは分岐状のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基等であって、これらの基に置換する基としては、ハロゲン原子(塩素原子、フッ素原子、臭素原子)、ヒドロキシ基、チオール基、カルボキシ基、スルホ基、シアノ基、エポキシ基、一〇R′基(R′は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、ヘキシル基、オクチニル基、デシル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、オクテニル基、2ーヒドロキシエチル基、3ークロロプロピル基、2ーシアノエチル基、N、Nージメチルアミノエチル基、2ーブロモエチル基、2ー(2ーメトキシエチル)オキシエチル基、2ーメトキシカルボニルエチル基、3ーカルボキシプロピル基、ベンジル基等を示す)、

[0067]

-OCOR''基(R''は、前記R'と同一の内容を表わす)、-COOR''基、-COR''基、-N(R''')(R'')

[0068]

炭素数 5~10の置換されてもよい脂環式基(例えば、シクロペンチル基、シクロペキシル基、2-シクロペンチルエチル基、ノルボニル基、アダマンチル基等であって、これらの基に置換する基としては、前記アルキル基の置換基と同一の内容のものが挙げられ、又複数置換してもよい)、炭素数 6~12の置換してもよいアリール基(例えばフェニル基、ナフチル基で、置換基としては前記アルキル基に置換する基と同一の内容のものが挙げられ、又、複数置換してもよい)、又は、窒素原子、酸素原子、イオウ原子から選ばれる少なくとも1種の原子を含有する縮環してもよいへテロ環基(例えば該ヘテロ環としては、ピラン環、フラン環、チオフェン環、モルホリン環、ピロール環、チアゾール環、オキサゾール環、ピリジン環、ピペリジン環、ピロリドン環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、キノリン環、テトラヒドロフラン環等で、置換基を含有してもよい。置換基としては、前記アルキル基中の置換基と同一の内容のものが挙げられ、又複数置換されてもよい)を表わす。

[0069]

- 一般式 (V) 中のYの $-OR^1$ 基、 $-OCOR^2$ 基又は $-N(R^3)(R^4)$ 基の置換基としては、例えば以下の置換基を表わす。
- -OR¹基において、R¹は炭素数 1~10の置換されてもよい脂肪族基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、ヘキシル基、ペンチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘプテニル基、ヘキセニル基、オクテニル基、デセニル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-メトキシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-メトキシエチル基、2-メトキシプロピル基、2-メトキシプロピル基、2-メトキシプロピル基、2-シアノエチル基、3-メチルオキサプロピル基、2-クロロエチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、シクロオクチル基、クロロシクロヘキシル基、メトキシシクロヘキシル基、ベンジル基、フェネチル基、ジメトキシベンジル基、メチルベンジル基、ブロモベンジル基等が挙げられる)を表わす。

[0070]

 $-OCOR^2$ 基において、 R^2 は、 R^1 と同一の内容の脂肪族基又は炭素数 6 \sim

12の置換されてもよい芳香族基(芳香族基としては、前記R中のアリール基で 例示したと同様のものが挙げられる)を表わす。

 $\mathbf{Z} - \mathbf{N} (\mathbf{R}^3) (\mathbf{R}^4)$ 基において、 \mathbf{R}^3 、 \mathbf{R}^4 は、互いに同じでも異なってもよく、各々、水素原子又は炭素数 $\mathbf{1} \sim \mathbf{1} \mathbf{0}$ の置換されてもよい脂肪族基(例えば、前記の $\mathbf{-OR}^1$ を同様の内容のものが挙げられる)を表わす。

より好ましくは、 R^3 と R^4 の炭素数の総和が16個以内である。

一般式(V)で示されるシラン化合物の具体例としては、以下のものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

[0071]

テトラクロルシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ イソプロポキシシラン、テトラーn-プロピルシラン、メチルトリクロルシラン 、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリクロルシ ラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、n-プロピルト リクロルシラン、n-プロピルトリブロムシラン、n-プロピルトリメトキシシ ラン、n-プロピルトリエトキシシラン、n-デシルトリメトキシシラン、n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘキシルト リメトキシシラン、フェニルトリクロルシラン、フェニルトリメトキシシラン、 フェニルトリエトキシシラン、ジメトキシジエトキシシラン、ジメチルジクロル シラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフェニルジ エトキシシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、トリエトキシヒドロシラン 、トリメトキシヒドロシラン、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリメトキシシ ラン、トリフルオロプロピルトリクロルシラン、トリフルオロプロピルトリメト ゙キシシラン、ァーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、ァーグリシド キシプロピルメチルジエトキシシラン、 y - グリシドキシプロピルトリメトキシ シラン、ァーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ァーメタアクリロイル プロピルメチルトリメトキシシラン、ァーメタアクリロキシプロピルトリt-ブ トキシシラン、ァーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、ァーアミノプロピ ルメチルジエトキシシラン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γーメル カプトプロピルメチルジメトキシシラン、ァーメルカプトプロピルメチルジエト

キシシラン、 γ - メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ - メルカプトプロピルトリエトキシシラン、 β - (3, 4 - エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン等が挙げられる。

[0072]

本発明の親水性層の無機親水性結着樹脂形成に用いる一般式(V)で示されるシラン化合物とともに、Ti、Zn、Sn、Zr、Al等のゾルーゲル変換の際に樹脂に結合して成膜可能な金属化合物を併用することができる。

用いられる金属化合物として、例えば、 $Ti(OR'')_4(R''$ はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等)、 $TiCl_4$ 、 $Zn(OR'')_2$ 、 $Zn(CH_3COCHCOCH_3)_2$ 、 $Sn(OR'')_4$ 、 $Sn(CH_3COCHCOCH_3)_4$ 、 $Sn(OCOR'')_4$ 、 $SnCl_4$ 、 $Zr(OR'')_4$ 、 $Zr(CH_3COCHCOCH_3)_4$ 、 $Al(OR'')_3$ 、 $Al(CH_3COCHCOCH_3)_4$ 、 $Al(OR'')_3$ 、 $Al(CH_3COCHCOCH_3)_3$ 等が挙げられる。

[0073]

更に、一般式(V)で示されるシラン化合物、更には併用する前記の金属化合物の加水分解及び重縮合反応を促進するために、酸性触媒又は塩基性触媒を併用することが好ましい。

[0074]

触媒は、酸あるいは塩基性化合物をそのままか、あるいは水またはアルコールなどの溶媒に溶解させた状態のもの(以下、それぞれ酸性触媒、塩基性触媒という)を用いる。そのときの濃度については特に限定しないが、濃度が濃い場合は加水分解、重縮合速度が速くなる傾向がある。但し、濃度の濃い塩基性触媒を用いると、ゾル溶液中で沈殿物が生成する場合があるため、塩基性触媒の濃度は1N(水溶液での濃度換算)以下が望ましい。

[0075]

酸性触媒あるいは塩基性触媒の種類は特に限定されないが、濃度の濃い触媒を 用いる必要がある場合には、焼結後に触媒結晶粒中にほとんど残留しないような 元素から構成される触媒がよい。具体的には、酸性触媒としては、塩酸などのハ ロゲン化水素、硝酸、硫酸、亜硫酸、硫化水素、過塩素酸、過酸化水素、炭酸、 蟻酸や酢酸などのカルボン酸、そのRCOOHで表される構造式のRを他元素または置換基によって置換した置換カルボン酸、ベンゼンスルホン酸などのスルホン酸など、塩基性触媒としては、アンモニア水などのアンモニア性塩基、エチルアミンやアニリンなどのアミン類などが挙げられる。

[0076]

以上述べたように、ゾルーゲル法によって作成される画像記録層は、本発明の平版印刷版用原版にとくに好ましい。上記のゾルーゲル法のさらに詳細は、作花済夫「ゾルーゲル法の科学」(株)アグネ承風社(刊)(1988年)、平島碩「最新ゾルーゲル法による機能性薄膜作成技術」総合技術センター(刊)(1992年)等の成書等に詳細に記述されている。

[0077]

本発明の平版印刷用原板の画像記録層には、ポリマー微粒子、親水性結着剤の他に、光を吸収して発熱する光熱変換剤、無機微粒子、界面活性剤、着色剤など感度の向上、親水性の程度の制御、画像記録層の物理的強度の向上、層を構成する組成物相互の分散性の向上、塗布性の向上、印刷適性の向上、製版作業性の便宜上などの種々の目的の化合物を添加することができる。以下これらについて説明する。

[0078]

光熱変換剤としては、金属、金属の酸化物、窒化物もしくは硫化物、顔料及び染料が好ましい。金属および金属化合物としては、A1、Si、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Mo、Ag、Au、Pt、Pd、Rh、In、Sn、Wからなる金属の中から選択された金属または金属化合物の中から選択された、粒子化して親水層の結着樹脂に分散し得るものを用いることができる。

特に、鉄、銀、白金、金、パラジウムの金属微粒子が好ましい。

その他、TiOx(x=1.0~2.0)、SiOx(x=0.6~2.0)、AlOx(x=1.0~2.0)、鍋、銀及び錫のアジド化物などの金属アジド化合物も好ましい。

上記の各金属酸化物、窒化物及び硫化物は、いずれも公知の製造方法によって

得られる。また、チタンブラック、鉄黒、モリブデン赤、エメラルドグリーン、カドミウム赤、コバルト青、紺青、ウルトラマリンなどの名称で市販されているものも多い。

[0079]

本発明の親水層に用いられる顔料は、上記の金属化合物及び金属のほかに、カーボンブラック、黒鉛(グラファイト)、骨炭(ボーンブラック)などの非金属単体粒子や各種の有機、無機顔料も光熱変換性微粒子として画像記録層に含有させることができる。また、粒子形態ではない光熱変換性の色素も画像記録層中に添加することができる。

[0080]

画像記録層に光熱変換剤として含有される色素は、照射光の分光波長領域に光吸収域を有し、かつ結着樹脂に分散されうる固体微粒子状の顔料及び照射光の分光波長領域に光吸収域を有し、かつ結着樹脂に染着性の、又は非染着性で分子分散性の色素である。好ましい固体微粒子状、染着性及び分子分散性の色素は、IR(赤外線)吸収剤であり、具体的には、ポリメチン色素、シアニン色素、スクアリリウム色素、ピリリウム色素、ジインモニウム色素、フタロシアニン化合物、トリアリールメタン色素、金属ジチオレンから選ばれる染料である。これらのうち更に好ましいものとしては、ポリメチン色素、シアニン色素、スクアリリウム色素、ピリリウム色素、ジインモニウム色素、シアニン色素、スクアリリウム色素、ピリリウム色素、ジインモニウム色素、シアニン色素、フタロシアニン化合物がもっとも好ましい。上記した色素は、水溶性基を分子内に有する水溶性染料であってもよい。水溶性の染料が有する好ましい水溶性基としては、スルホン酸基、カルボキシル基及びホスホン酸基を挙げることができる。

画像記録層に含有される光熱変換剤として用いられる染料(赤外線吸収剤)の 具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

[0081]

【化14】

$$\begin{array}{c} \text{(IR-3)} \\ \text{H}_3\text{CNHCONH} \\ \text{(CH}_2)_2\text{SO}_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{(CH}_2)_2\text{SO}_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{(CH}_2)_2\text{SO}_3 \\ \end{array} \\ \text{NHCONHCH}_3 \\ \text{N$$

[0082]

【化15】

[0083]

画像記録層中への光熱変換剤の添加は、上記の光熱変換剤を画像記録層の塗布 液中に添加してもよいが、疎水性ポリマー微粒子中に含有させて添加することも できる。すなわち、疎水性ポリマー微粒子を製造するときの油相に添加することによって、ポリマー微粒子中に含有させることができる。その場合には、上記の 光熱変換剤でもよいが、疎水性ポリマーと親和性の良い親油性光熱変換剤を用い ることが好ましい。そのような親油性光熱変換剤を以下に例示するが、これに限 定されるものではない。

[0084]

【化16】

[0085]

【化17】

(IR-27) M=VO, R=i-C₅H₁₁

(IR-28)

$$(C_2H_5)_2N$$
 BF_4
 $N(C_2H_5)_2$

[0086]

画像記録層中に含まれる光熱変換剤の含有量は、光熱変換剤の光吸収により発生する熱によってポリマー微粒子の近傍が熱融着を引き起こして疎水化するのに足りる量であればよく、固形の構成成分の2~50質量%の間で広く選択できる。2質量%以下では発熱量が不足して感度が低下し、50質量%以上では膜強度が低下する。

[0087]

本発明の画像記録層には無機微粒子を添加してもよく、無機微粒子としては、 シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化チタン、炭酸マグネシウム、アルギン酸カルシウムもしくはこれらの混合物などが好適な例として挙げられ、これら は光熱変換性でなくても皮膜の強化や表面粗面化による界面接着性の強化などに .用いることができる。

[0088].

無機微粒子の平均粒径は5 n m~1 0 μ mのものが好ましく、より好ましくは 1 0 n m~1 μ mである。粒径がこの範囲内で、ポリマー微粒子や光熱変換剤の 金属微粒子とも結着樹脂内に安定に分散し、画像記録層の膜強度を充分に保持し、印刷汚れを生じにくい親水性に優れた非画像部を形成できる。

このような無機微粒子は、コロイダルシリカ分散物などの市販品として容易に 入手できる。

無機微粒子の画像記録層への含有量は、画像記録層の全固形分の1.0~70 重量%が好ましく、より好ましくは5.0~50重量%である。

[0089]

画像記録層に用いられる界面活性剤としては、ポリマー微粒子の製造に用いる ことができるものと同様の界面活性剤を使用できる

画像記録層には、場合によりさらに、具体的にはパーフルオロアルキル基を有する界面活性剤が好ましく、カルボン酸、スルホン酸、硫酸エステル及びリン酸エステルのいづれかを有するアニオン型の界面活性剤、又は、脂肪族アミン、第4級アンモニウム塩のようなカチオン型の界面活性剤、又はベタイン型の両性界面活性剤、又は、ポリオキシ化合物の脂肪族エステル、ポリアルキレンオキシド縮合型、ポリエチレンイミン縮合型のようなノニオン型界面活性剤などが挙げられる。

上記界面活性剤の画像記録層全固形物中に占める割合は、0.05~15質量%が好ましく、より好ましくは0.1~5質量%である。

[0090]

又本発明の画像記録層には、画像形成後、画像部と非画像部の区別をつきやすくするため、可視光域に大きな吸収を持つ染料を画像の着色剤として使用することができる。具体的には、オイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業(株)製)、ビクトリアピュアブルー、クリスタ

ルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42535)、エチルバイオレット、ローダミンB(CI145170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレンブルー(CI52015)等、および特開昭62-293247号に記載されている染料を挙げることができる。また、フタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、酸化チタンなどの顔料も好適に用いることができる。添加量は、画像記録層の全固形分に対し、0.01~10重量%の割合である。

[009.1]

[断熱層]

本発明の平版印刷用原板には必須ではないが、支持体と画像記録層の間に断熱層を設けることが好ましい。以下に、断熱層について説明する。

感光層の下層として設けられている断熱層は、熱伝導率が低く支持体への熱拡散を抑制する機能を有する層である。さらに、断熱層には、光熱変換剤を含有させることもでき、その場合には光照射によって発熱して熱融着感度の向上に寄与する。

このような断熱層は、有機性又は無機性の樹脂を含有することからなる。

[0092]

有機性あるいは無機性の樹脂は、親水性あるいは、疎水性のものから広く選択することができる。例えば、疎水性を有する樹脂としてはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ニトロセルロース、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂ー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニルービニルアルコール共重合体、塩化ビニルー樹脂ビニルーマレイン酸共重合体、塩化ビニルーアクリレート共重合体、ポリ塩化ビニリデン、塩化ビニリデンーアクリロニトリル共重合体などが挙げられる。

[0093]

本発明では、疎水性を有する樹脂は、水性エマルジョンから構成されたものも用いることができる。水性エマルジョンとは、微小なポリマー粒子と、必要に応

じて該粒子を分散安定化する保護剤とからなる粒子を水中に分散させた疎水性ポリマー懸濁水溶液のことである。

用いられる水性エマルジョンの具体例としては、ビニル系ポリマーラテックス (ポリアクリレート系、酢酸ビニル系、エチレンー酢酸ビニル系など)、共役シ エン系ポリマーラテックス(メタクリル酸メチルーブタジエン系、スチレンーブ タジエン系、アグリロニトリループブタジエン系、クロロプレン系など)及びポ リウレタン樹脂などが挙げられる。

[0.094]

次に、親水性を有する樹脂としては、具体的には、ポリビニルアルコール(PVA),カルボキシ変性PVA等の変性PVA,澱粉及びその誘導体、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースのようなセルロース誘導体、アルギン酸アンモニウム、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸塩、ポリエチレンオキサイド、水溶性ウレタン樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート系ポリマー、Nービニルカルボン酸アミドポリマー、カゼイン、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、酢酸ビニルークロトン酸共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体等の水溶性樹脂、などが挙げられる。

[0095]

また、上記親水性を有する樹脂を架橋し、硬化させて用いることが好ましく、 架橋剤(耐水剤ともいう)としては、前記した画像記録層に用いたものと同じ耐 水剤を使用することができる。

[0096]

さらに、無機高分子としては、ゾルゲル変換によって形成される無機マトリックスが好ましい。本発明に好ましく適用できるゾルゲル変換が可能な系は、多価元素に結合した結合基が酸素原子を介して網目状構造を形成し、同時に多価金属は未結合の水酸基やアルコキシ基も有していてこれらが混在した樹脂状構造となっている高分子体であって、アルコキシ基や水酸基が多い段階ではゾル状態であり、脱水縮合が進行するのに伴って網目状の樹脂構造が強固となる。

また、樹脂組織の親水性度が変化する性質に加えて、水酸基の一部が固体微粒

子に結合することによって固体微粒子の表面を修飾し、親水性度を変化させる働きをも併せ持っている。ゾルゲル変換を行う水酸基やアルコキシ基を有する化合物の多価結合元素は、アルミニウム、珪素、チタン及びジルコニウムなどであり、これらはいずれも本発明に用いることができる。

[0097]

画像記録層との接着性の観点から、これら樹脂のうち、とくに親水性樹脂が好ましい。

断熱層中に光熱変換剤を含有させる場合、その光熱変換剤としては、前記した 画像記録層に用いた光熱変換剤と同じ物質を使用することができる。

断熱層中に含まれる光熱変換剤の含有量は、固形の構成成分の2~95質量%の間で広く選択できる。2質量%以下では発熱量が不足して添加の効果が顕著でなく、95質量%以上では膜強度が低下する。

断熱層中には、上記した樹脂及び光熱変換剤のほかに、断熱層の物理的強度の向上、層を構成する組成物相互の分散性の向上、塗布性の向上、画像記録層との接着性向上などの理由で、無機微粒子、界面活性剤など種々の目的の化合物を添加することができる。

[0098]

断熱層に添加する無機微粒子としては、前述した画像記録層に添加するものと 同様の無機微粒子を添加することができて、同様の効果を挙げることができる。

無機微粒子を断熱層中に添加する場合の含有量も画像記録層に添加する場合と同じ添加量の範囲である。

[0099]

画像記録層に添加することができるものとして記載したものが、断熱層にも使用することができる。その添加量も画像記録層に関して記載した範囲と同じである。

[0100]

[水可溶性の保護層]

水可溶性の保護層は、本発明の平版印刷原板の表面が親水性であるので、原板が製品形態で輸送されたり、保管されたりする際、あるいは使用前の取り扱いの

際、環境の雰囲気の影響によって疎水性化したり、温湿度の影響を受けたり、あるいは機械的な傷など又は汚れなどの影響を受けやすい。そのため本発明の平版 印刷用原板には、これを防止するために、水溶性高分子を主成分とする水可溶性 の表面保護層を設けることが好ましいが、表面保護層は本発明に必須ではない。

水可溶性の保護層は、印刷の初期の段階で湿し水に溶解して洗い去られるので、特に除去の手間をかける必要はなく、印刷の支障にはならない。

以下、水可溶性の保護層に含有される成分について説明する。

[0101]

水可溶性保護層に含有される水溶性高分子は、水可溶性層の結着樹脂として機能する。水溶性高分子としては、例えば水酸基、カルボキシル基、塩基性窒素含有基等の基を十分に有する高分子が挙げられる。

[0102]

具体的には、ポリビニルアルコール(PVA)、カルボキシ変性PVA等の変性PVA、アラビアガム、水溶性大豆多糖類、ポリアクリルアミド及びその共重合体、アクリル酸共重合体、ビニルメチルエーテル/無水マレイン酸共重合体、酢酸ビニル/無水マレイン酸共重合体、スチレン/無水マレイン酸共重合体、焙焼デキストリン、酸素分解デキストリン、酵素分解エーテル化デキストリン、澱粉及びその誘導体、カルボキシメチルセルローズ、カルボキシエチルセルローズ、メチルセルローズ、ヒドロキシエチルセルローズのようなセルロース誘導体、カゼイン、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、酢酸ビニルークロトン酸共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、アルギン酸及びそのアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩、ポリアクリル酸、ポリ(エチレンオキサイド)、水溶性ウレタン樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、Nービニルカルボン酸アミドポリマー等が挙げられる。

なかでも、ポリビニルアルコール(PVA)、カルボキシ変性PVA等の変性PVA、アラビアガム、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、アクリル酸共重合体、ポリビニルピロリドン、アルギン酸及びそのアルカリ金属塩の使用が好ましい。

[0103]

塗布液中の上記水溶性樹脂の含有量は、3~25質量%が適当であり、好ましい範囲は10~25質量%である。

なお、本発明においては上記水溶性樹脂を2種以上混合使用してもよい。

[0104]

水可溶性の保護層は他の成分として、種々の界面活性剤を含有してもよい。使用できる界面活性剤としてはアニオン界面活性剤又はノニオン界面活性剤が挙げられる。用いられる界面活性剤としては、前記した画像記録層に用いられる界面活性剤と同様なものを用いることができる。界面活性剤は水可溶性層の全固形分当たり、好ましくは0.01~1質量%であり、更に好ましくは0.05~0.5質量%である。

[0105]

上記成分のほか、必要により湿潤剤としてグリセリン、エチレングリコール、トリエチレングリコール等の低級多価アルコールも使用することができる。これら湿潤剤の使用量は表面保護層中に 0. 1~5. 0質量%となる量が適当であり、好ましい範囲は 0. 5~3. 0質量%となる量である。以上の他に本発明の平版印刷用原板の表面保護層の塗布液には、防腐剤などを添加することができる。例えば安息香酸及びその誘導体、フェノール、ホルマリン、デヒドロ酢酸ナトリウム等を 0. 005~2. 0質量%の範囲で添加できる。

塗布液には消泡剤を添加することもできる。好ましい消泡剤には有機シリコーン化合物が含まれ、その添加量はO.0001~O.1質量%の範囲が好ましい

[0106]

また、水溶性の保護層には、光熱変換剤を添加してもよい。この場合、画像記録層の光照射による熱融着の感度がさらに高まるので、好ましい結果が得られる。光熱変換剤としては、断熱層に添加してもよい光熱変換剤として前記したものを前記した添加量の範囲で使用することができる。

[0107]

[塗布]

上記した画像記録層、断熱層、保護層は、それぞれ各構成成分を混合し、調整 された塗布液を支持体上に、従来公知の塗布方法のいずれかを用いて、塗布・乾 燥し、塗布層を形成する。

塗布する方法としては、公知の種々の方法を用いることができるが、例えば、 バーコター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エア ーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。

[0108]

塗布、乾燥後に得られる画像記録層塗布量(固形分)は、用途によって異なるが、一般的な平版印刷版用原板についていえば、 $0.1\sim30\,\mathrm{g/m^2}$ が好ましく、 $0.3\sim10\,\mathrm{g/m^2}$ がより好ましい。

[0109]

断熱層塗布量(固形分)も、構成によって異なるが、一般的な平版印刷版用原板についていえば、 $0.1\sim10\,\mathrm{g/m^2}$ が好ましく、 $0.3\sim5\,\mathrm{g/m^2}$ がより好ましい。

保護層塗布量(固形分)も、構成によって異なるが、一般的な平版印刷版用原板についていえば、 $0.1\sim5$ g/m 2 が好ましく、 $0.2\sim3$ g/m 2 がより好ましい。

塗布は、通常、断熱層、画像記録層、保護層の順序で行われる。

[0110]

[支持体]

つぎに画像記録層を塗設する支持体について述べる。

支持体には、寸度的に安定な板状物が用いられる。本発明に用いることができる支持体としては、紙、プラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅、ニッケル、ステンレス鋼等)、プラスチックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記の金属がラミネート又は蒸着された紙もしくはプラスチックフィルム

等が含まれる。

[0111]

好ましい支持体は、ポリエステルフィルム、アルミニウム、又は印刷版上で腐食しにくいSUS鋼板であり、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板が好ましい。

好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、 微量の異元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは蒸着 されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素には 、珪素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル 、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々10質量%以下である。本 発明において特に好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋 なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに異元素を含有するも のでもよい。このように本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定 されるものではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用す ることができる。本発明で用いられる支持体の厚みはおよそ0.05mm~0. 6mm程度、好ましくは0.1mm~0.4mm、特に好ましくは0.15mm ~0.3mmである。

[0112]

アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去する ための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理 が行われる。

アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。化学的方法としては、特開昭54-31187号公報に記載されているような鉱酸のアルミニウム塩の飽和水溶液に浸漬する方法が適している。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸などの酸を含む電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示され

ているように混合酸を用いた電解粗面化方法も利用することができる。

このような粗面化方法のうち、特に特開昭55-137993号公報に記載されているような機械的粗面化と電気化学的粗面化を組合せた粗面化方法が、感脂性画像の支持体への接着力が強いので好ましい。

上記の如き方法による粗面化は、アルミニウム板の表面の中心線表面粗さ(Ra)が $0.3 \sim 1.0 \mu$ mとなるような範囲で施されることが好ましい。

粗面化されたアルミニウム板は必要に応じて水酸化カリウムや水酸化ナトリウムなどの水溶液を用いてアルカリエッチング処理がされ、さらに中和処理された後、所望により耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。

[0113]

アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、塩酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

陽極酸化の処理条件は、用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が $1\sim8$ 0質量%溶液、液温は $5\sim7$ 0 $^{\circ}$ 0、電流密度 $5\sim6$ 0 A/dm $^{\circ}$ 、電圧 $1\sim1$ 00 V、電解時間10秒 ~5 分の範囲であれば適当である。

形成される酸化皮膜量は、 $1.0\sim5.0~\rm{g/m}^2$ 、特に $1.5\sim4.0~\rm{g/m}^2$ であることが好ましい。陽極酸化皮膜の量は $1.0~\rm{g/m}^2$ より少ないと耐刷性が不十分であったり、傷が付き易くなる。

[0114]

これらの陽極酸化処理の内でも、とくに英国特許第1,412,768号公報に記載されている硫酸中で高電流密度で陽極酸化する方法及び米国特許第3,5 11,661号公報に記載されている燐酸を電解浴として陽極酸化する方法が好ましい。

[0115]

断熱層が疎水性を有する樹脂の場合は、支持体表面を疎水性化することが望ま しい。支持体表面の疎水性化処理は、たとえばシランカップリング剤や、場合に よってはチタンカップリング剤を含んだ下塗り液を塗布することによって行われる。シランカップリング剤はおもに一般式(RO)3 SiR'(R,R'はアルキル基や置換アルキル基)で表され、RO基は加水分解してOH基となって支持体表面とエーテル結合で結合し、R'基がインキを受容する疎水性の表面を提供する。

[0116]

シランカップリング剤としては、 γ - クロロプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β - メトキシエトキシ)シラン、 γ - メタクロキシプロピルトリメトキシシラン、 γ - グリコキシドキシピロピルトリメトキシシラン、 γ - アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ - メルカプトトリメトキシシラン、 γ - ウレイドプロピルトリエトキシシラン、 γ - (β - アミノエチル) - (β - アミノプロチル)ジメトキシシランなどが挙げられる。

画像記録層との密着性を確保するためには、プラスチック支持体は塗布の前に 公知の方法で帯電処理が施される。

[0117]

[製版および印刷]

本発明の平版印刷用原板は熱により画像形成される。具体的には、熱記録へッド等による直接画像様記録、赤外線レーザによる走査露光、キセノン放電灯などの高照度フラッシュ露光や赤外線ランプ露光などが用いられるが、波長700~1200nmの赤外線を放射する半導体レーザ、YAGレーザ等の固体高出力赤外線レーザによる露光が好適である。

本発明の平版印刷用原板は、レーザー出力が 0. $1\sim300$ Wのレーザーで照射をすることができる。また、パルスレーザーを用いる場合には、ピーク出力が 1000 W、好ましくは 2000 Wのレーザーを照射するのが好ましい。この場合の露光量は、印刷用画像で変調する前の面露光強度が $0.1\sim10$ J/c m 2 の範囲であることが好ましく、 $0.3\sim1$ J/c m 2 の範囲であることがより好ましい。

支持体が透明である場合は、支持体の裏側から支持体を通して露光することも

できる。

[0118]

画像露光された本発明の平版印刷用原板は、それ以上の処理なしに印刷機に装着し、インキと湿し水を用いて通常の手順で印刷することができる。

また、これらの平版印刷用原板は、印刷機シリンダー上に取りつけた後に、印刷機に搭載されたレーザーにより露光し、そのままインキと湿し水を用いて通常の手順で印刷することもできる。

さらに、場合によっては、露光後、機上現像することもできる。

[0119]

【実施例】

以下実施例に基づき、本発明を具体的に説明するが、本発明が実施例により限 定されて解釈されることはない。

[0120]

実施例1<疎水性ポリマー微粒子1の製造>

油相成分として、疎水性ポリマー(本明細書記載のPI-1)30.0g、MEK45.0g、アニオン界面活性剤パイオニンA41C(竹本油脂(株)製)0.5gの溶液を調製し、水相成分として、水溶性樹脂(本明細書記載のWII-1)4.2g、水259.8gの溶液を調製し、両者を混合した後、ホモジナイザーにて12,000rpm、10分間激しく攪拌混合して、水相中に油滴を分散した乳化分散物を得た。次に、ステンレス製ポットに乳化分散物を投入し、40℃3時間攪拌して溶剤成分を除去することによって、粒径0.24 μ mの疎水性ポリマー微粒子1を得た。

[0121]

実施例2~25及び比較例1~3

実施例1で用いた疎水性ポリマー、水溶性樹脂、界面活性剤を表1記載の材料にそれぞれ置き換えた以外は実施例1と同様にポリマー微粒子2~25の製造を行った。結果を表1に示す。

[0122]

【表1】

表1:実施例1~25および比較例1~3

			, ,		
実施例	疎水性ポリ マー	酸化物又は 水酸化物 微粒子	水溶性樹脂	界面活性剤	粒子径 (μm)
実施例1	P I - 1	なし'	W∏− 1	パイホニン A41C	0.24
実施例2	PI-1	なし	WII-2	パペイオニン A41C	0.27
実施例3	PI-1	なし	WII – 3	パペイオニン A41C	0.25
実施例4	PI-1	なし	WII - 4	パ [°] イオニン A41 C	0.33
実施例5	PI-1	なし	WII – 5	パ°イオニン A41C	0.29
実施例 6	PI-1	なし	WII – 6	パペイオニン A41C	0.51
実施例7	PI-1	なし	WII – 7	パペイオニン A41 C	0.46
実施例8	P I - 1	なし	WII – 8	パペイオニン A41C	0.73
実施例9	PI-1	なし	WIII — 1	パイオニン A41 C	0.88
実施例10	P I - 1	なし	WIII – 2	パペイオニン A41C	0.22
実施例11	PI-1	なし	WⅢ—3	パイオニン A41C	0.95
実施例12	P I - 1	なし	W∏1 − 4	パイオニン A41C	0.12
実施例13	P I - 1	なし	WⅢI — 5	パイ たン A41C	0.75
実施例14	PI-1	なし	WIII — 6	እ°	0.46
実施例 1 5	PI-1	なし	WIII – 7	パイオニン A41C	0.32
実施例 1 6	PI-1	なし	WПІ— 8	パペイたン A41C	0.57
実施例17	P I - 1	なし	WIII — 9	パペイオニン A41C	0.67
実施例 18	PI-1	なし	WIII - 1 0	パペイポニン A41C	0.34
実施例19	PI-1	スノーテックス C	WII – 1	パペイポニン A41C	0.20
実施例20	PI-1	チタニアソ*ル	WII – 1	パペイオニン A41C	0.38
実施例21	PI-1	スノーテックス C	WII – 1	17-1 NC	0.23
実施例22	PI-2	なし	WII-1	パペイオニン A41C	0.30
実施例 2 3	PI-3	なし	WII – 1	パイオニン A41C	0.27
実施例 2 4	PI-4	なし	WII – 1	パペイオニン A41C	0.34
実施例 2 5	PI-5	なし	WII-1	パペイオニン A41C	0.25
比較例1	P I - 1	なし	PVA105	パペイオニン A41C	粒子形成せず
比較例2	PMMA	なし	WII – 1	パペイオニン A41C	粒子形成せず
比較例3	PMMA	なし	PVA205	なし	0.21

[0123]

表中の略号および商品名は、下記の通りである。

PMMA:ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量15,000)

スノーテックスC:日産化学工業(株)製、コロイダルシリカ20%水溶液

チタニアゾル:石原産業(株)製STS-01

PVA105: (株) クラレ製ポリビニルアルコール、ケン化度98.8%

PVA205: (株) クラレ製ポリビニルアルコール、ケン化度88.0%

パイオニンA41C: 竹本油脂(株)製アニオン界面活性剤エマールNC: 花王(株)製アニオン界面活性剤

[0124]

以上の結果から、本発明のポリマー微粒子の製造においては、疎水性ポリマーおよび水溶性樹脂の双方に有機珪素官能基が必須の構成要素であることが明らかである。

[0125]

実施例26<光熱変換剤を内包する疎水性ポリマー微粒子26の製造>

実施例3のポリマー微粒子作製時に、油相成分に光熱変換剤(本明細書記載のIR-26)5.0gを追加した以外は実施例3と同様の方法で、光熱変換剤を内包した疎水性ポリマー微粒子26を作製した。粒子径は0.30μmであった

[0126]

実施例27<疎水性ポリマー微粒子27の製造>

油相成分として、疎水性ポリマー(PI-1)を20.0g、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量15,000)10.0g、MEK45.0g、界面活性剤パイオニンA41C(竹本油脂(株)製)0.5gの溶液を調製し、水相成分として、水溶性樹脂(WII-1)を4.2g、水295.8gの溶液を調製し、両者を混合した後、ホモジナイザーにて12,000rpm、10分間激しく攪拌混合して、水相中に油滴を分散した乳化分散物を得た。次に、ステンレス製ポットに乳化分散物を投入し、40℃3時間攪拌して溶剤成分を除去することによって、粒径0.21μmの疎水性ポリマー微粒子27を得た。

[0127]

実施例28<疎水性ポリマー微粒子28の製造>

油相成分として、疎水性ポリマー (PI-1) を25.0g、光熱変換剤(本明細書記載のIR-24) 5.0g、MEK45.0g、界面活性剤パイオニンA41C(竹本油脂(株)製) 0.5gの溶液を調製し、水相成分として、水溶性樹脂(WII-1)を4.2g、水295.8gの溶液を調製し、両者を混合した後、ホモジナイザーにて12,000rpm、10分間激しく攪拌混合して、

水相中に油滴を分散した乳化分散物を得た。次に、ステンレス製ポットに乳化分散物を投入し、40 $\mathbb C$ 3 時間攪拌して溶剤成分を除去することによって、粒径 0 . 35μ mの疎水性ポリマー微粒子 28 を得た。

[0128]

実施例29 (平版印刷用原板の作製と評価)

99.5質量%アルミニウムに、銅を0.01質量%、チタンを0.03質量%、鉄を0.3質量%、ケイ素を0.1質量%含有するJISA105のアルミニウム材の厚み0.24mm圧延板を、400メッシュのバミストン(共立窯業製)の20質量%水性懸濁液と、回転ナイロンブラシ(6,10-ナイロン)とを用いてその表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。

[0129]

次に、10質量%水酸化ナトリウム水溶液に70℃で60秒間浸漬してエッチングした後、流水で水洗した。更に、20質量%硝酸水溶液で中和し、水洗浄した。得られたアルミニウム板を1.0質量%硝酸水溶液(硝酸アルミニウム0.5質量%含有)中で、陽極時電圧12.7ボルト、陽極時電気量に対する陰極時電気量の比が0.9、陽極時電気量160クローン/100条件の矩形波交番波形の電流を用いて電解粗面化処理を行った。得られた基板の表面粗さは、100.

この処理に続いて、40 \mathbb{C} の 1 質量%水酸化ナトリウム水溶液中に 30 秒間浸漬して、エッチングした後、水洗した。次に、55 \mathbb{C} 、30 質量%の硫酸水溶液中に 1 分間浸漬した。

さらに、35 \mathbb{C} の硫酸 20 質量%水溶液(アルミニウム 0.8 質量%含有)中で直流電流を用いて、陽極酸化皮膜質量が 2.5 g / d m 2 となるように陽極酸化処理を行った。これを水洗、乾燥して支持体を作製した。

[0130]

次に、下記組成からなる画像記録層塗布液を、上記アルミニウム支持体上にバーコーターにて、乾燥膜質量が3.0 g/m^2 になるように塗布を行い、次いでオーブンにて100 $\mathbb C$ 3分間乾燥して、平版印刷用原板を作製した。

[0131]

(画像記録層塗布液組成)

コロイダルシリカ分散物20%水溶液	150 g
ゾルゲル調製液	6 6 g
疎水性ポリマー微粒子1(10質量%水分散物)	400g
光熱変換剤(本明細書記載のIR-10)	1 0 g
水	374 g

[0132]

ここに使用したゾルゲル調製液は、下記組成の溶液を調製し、室温で2時間熟成したものである。

[0133]

(ゾルゲル調製液組成)

テトラメトキシシラン	150g
エタノール	300g
0. 1モル/リットル硝酸	J
[0.1.0.4]	4 5 g

[0134]

得られた印刷原板表面の水滴接触角を測定したところ、拡張濡れを示して非常 に親水性の高い表面であった。

この平版印刷用原板を、水冷式40W赤外線半導体レーザーを搭載したクレオ 社製トレンドセッター3244VFSにて外面ドラム回転数100г p m、版面 エネルギー200 m J / c m²、解像度2400dpiの条件で露光し、露光部 表面に画像領域を形成した。この印刷版の照射領域表面の水滴接触角は102度 で、疎水性の高い表面に変化したことを示した。その後現像処理することなく、 印刷に用いた。

[0135]

印刷機にハイデルベルグ社製印刷機SOR-Mを用い、湿し水にEU-3 (富士写真フイルム(株)製)の1容量%水溶液を用い、インキはGEOS(N)墨を用いた。

はじめに、湿し水で10回転ロールアップ(ならし運転)を行い、次いでインキを供給して印刷を開始し、20,000枚まで印刷汚れがなく、髙品質な印刷

物が得られた。

[0136]

実施例30~56 (平版印刷用原板の作製と評価)

実施例29の画像記録層に用いた疎水性ポリマー微粒子1の代わりに、実施例30~56に、それぞれ前記の疎水性ポリマー微粒子2~28を対応させて用いた以外は、実施例29と同様に印刷用原板を作成し、レーザー露光による像様照射及び印刷を行い、評価した。その結果、いずれの実施例も、印刷原板表面の親水性は非常に高く、また、照射領域表面の疎水化の度合いは十分大きく、刷り出しの着肉性に優れ、20,000枚まで印刷汚れがなく、高品質な印刷物が得られた。

[0137]

比較例4 (比較用の平版印刷用原板の作製と評価)

比較例3で得たポリマー微粒子を用いた以外は、実施例29と同様に平版印刷用原板を作製し、実施例29と同様にレーザー露光による像様照射及び印刷を行い、評価した。その結果、いずれの刷版も刷りだしの着肉性は良好であったが、1万枚を越えた時点で地汚れが発生した。また、2万枚の時点では、画像部の摩耗による着肉不良が発生し、良好な印刷物を得ることが出来なかった。

[0138]

実施例57(平版印刷用原板の作製と評価)

実施例29のアルミニウム支持体と画像記録層の間に下記組成の断熱層(乾燥塗布量1.0 g/m^2)を設けた以外は、実施例29と同様に版材を作成した。

[0139]

(断熱層塗布液の組成)

ブチラール樹脂 BM-S (積水化学 (株) 製) 10%ME K溶液 59 g カーボンブラック分散物 (固形分21%) 13.5 g

MEK (メチルエチルケトン)

62.7g

[0140]

次いで、レーザー露光による像様照射及び印刷を行った。結果は、実施例 28 と比較して、少ない露光エネルギー(版面エネルギー $150\,\mathrm{m\,J/c\,m^2}$)で画

像形成が可能であり、実施例29と同様に20,000枚まで印刷汚れがなく、 高品質な印刷物が得られた。

[.0141]

実施例58 (平版印刷用原板の作製と評価)

実施例29の画像記録層で使用した光熱変換剤(IR-10)をCarey-Lea法で作製した銀コロイド(平均粒子径10nm)に置き換えた以外は、実施例29と同様に版材を作成した。

得られた印刷原板表面の水滴接触角を測定したところ、拡張濡れを示して非常 に親水性の高い表面であった。

次いで、レーザー露光による像様照射及び印刷を行った。結果は、実施例29 と同様に画像形成が可能であり、20,000枚まで印刷汚れがなく、高品質な 印刷物が得られた。

[0142]

実施例59 (平版印刷用原板の作製と評価)

下記組成の水可溶性保護層の塗布液を、実施例 2 9 記載の印刷版用原板の親水性画像記録層上にバーコーターにて 0.5 g/m 2 の乾燥膜厚みになるように塗布し、オーブン中で 100 \mathbb{C} 1 分間乾燥した。

[0143]

(水可溶性保護層の塗布液)

ポリアクリル酸(平均分子量20,000)10%溶液

350g

光熱変換剤(IR-10)(1質量%水溶液)

2.5g

[0144]

次いで、レーザー露光による像様照射及び印刷を行った。結果は、実施例 29 と比較して、少ない露光エネルギー(版面エネルギー $150\,\mathrm{m}\,\mathrm{J/c\,m^2}$)で画像形成が可能であり、実施例 $292\,\mathrm{E}$ と同様に $2000\,\mathrm{E}$ の $000\,\mathrm{E}$ を印刷汚れがなく、高品質な印刷物が得られた。

[0145]

実施例60(平版印刷用原板の作製と評価)

実施例29のアルミニウム支持体を、表面にコロナ処理を施した180_μm厚

PETベースに置き換えた以外は、実施例29と同様に版材を作成し、レーザー露光による像様照射及び印刷を行い、評価した。その結果、印刷原板表面の親水性は非常に高く、また、照射領域表面の疎水化の度合いは十分大きく、刷り出しの着肉性に優れ、20,000枚まで印刷汚れがなく、高品質な印刷物が得られた。

[0146]

実施例61 (平版印刷用原板の作製と評価)

実施例29で作製したアルミニウム支持体上に、下記組成からなる画像記録層の塗布液をバーコーターにて、乾燥膜質量が $1.0g/m^2$ になるように塗布を行い、次いでオーブンにて60%2分間乾燥した。

[0147]

(画像記録層の塗布液組成)

ポアクリル酸(平均分子量20,000)10%溶液

100g

疎水性ポリマ微粒子26 (10質量%)

900g

[0148]

このようにして得られた機上現像可能な平版印刷版を、水冷式40W赤外線半導体レーザを搭載したクレオ社製トレンドセッター3244VFSにて、出力9W、外面ドラム回転数105rpm、版面エネルギー200mJ/cm²、解像度2400dpiの条件で露光した後、処理することなく、ハイデルベルグ社製印刷機SOR-Mのシリンダーに取付け、湿し水を供給した後、インキを供給し、さらに紙を供給して印刷を行ったところ、問題なく機上現像ができ、20,000枚まで印刷汚れがなく、高品質な印刷物が得られた。

[0149]

【発明の効果】

本発明によれば、露光後、処理を行うことなく直接印刷機に装着して印刷することが可能な平版印刷用原板を製造するのに適したポリマー微粒子の製造方法、およびこの方法で製造したポリマー微粒子を用いた汚れ難さおよび耐刷性の改良された平版印刷用原板を提供できる。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 露光後、処理を行うことなく直接印刷機に装着して印刷することが可能な平版印刷用原板を製造するのに適した高親水性表面を有するポリマー微粒子の製造方法、およびこの方法で製造したポリマー微粒子を用いた汚れ難さの改良された平版印刷用原板を提供する。

【解決手段】 特定の有機珪素基をもつ疎水性ポリマーを、特定の有機珪素基をもつ親水性樹脂を用いて分散することを特徴とする疎水性ポリマー微粒子の製造方法、及び該ポリマー微粒子を含有し、熱により疎水性となる親水性の画像記録層を有することを特徴とする平版印刷用原板。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名 富士写真フイルム株式会社